クエン酸塩溶液中における歯科用アマルガムの電位走査曲線

野元 成晃1 田中 昌一2 神山 明生3 横瀬 勝美4,5

Potential sweep polarization curves of dental amalgams in citrate solutions

Shigemitsu Nomoto¹, Shoichi Tanaka², Akemi Nasuda-Kouyama³ and Katsumi Yokose^{4,5}

Abstract

The polarization behavior of different types of dental amalgam in 50mM citrate solutions with or without sodium chloride was studied by the potential sweep method with a sweep rate of 200mV/s. The dental amalgam electrodes were prepared from a conventional amalgam alloy and three high-copper amalgam alloys, following the manufacturers' instructions with regard to mercury-alloy ratios and trituration times. In the absence of chloride ions, it was found that oxidation of tin in the conventional amalgam decreased as the pH was increased. The build-up of anodic current was shifted toward more cathodic potentials as the pH was increased, representing the equilibrium potential shift for oxidation of tin. In the presence of chloride ions, the conventional amalgam displayed a current peak associated with the oxidation of silver in dental amalgam. In the absence of chloride ions, the high-copper amalgams exhibited peaks associated with the formation of copper oxide, but the polarization curves showed no evidence of the reduction step, which suggests that the peak current was almost consumed by the dissolution of copper in the amalgam. In the presence of chloride ions, the high-copper amalgams showed reaction current peaks for copper.

Key words : citrate, copper, corrosion, dental amalgam, tin

緒 言

歯科用金属の腐食は溶液 pH に依存するので 腐食試験溶液には緩衝液の使用が望まれる。ク エン酸は三塩基酸であり,弱酸性領域で優れた 緩衝剤として働き,また,様々な食品に含有さ れ,口腔内の歯科用金属と接する酸であること から,注目すべき酸であると考えられる。著者 ら¹⁾は,この様な考えから100 mM クエン酸塩 溶液中における歯科用アマルガムの電気化学的 挙動を検討した。高濃度である程緩衝能が高く, 電気化学的測定も行い易いが,100 mM は口腔 内環境を考えると高濃度に過ぎることから,本 測定ではクエン酸塩濃度50 mM を中心に歯科

1日本大学総合科学研究所 ¹Research Center of Nihon University ²田中歯科医院 ² Tanaka Dental Clinic ³日本大学歯学部物理学教室 ³Department of Physics, Nihon University School of 4日本大学歯学部化学教室 Dentistry 5日本大学歯学部総合歯学研究所機能形態部門 ⁴Department of Chemistry, Nihon University School of 〒101-8310 東京都千代田区神田駿河台1-8-13 Dentistry (受理: 2006年9月28日) ⁵Division of Functional Morphology, Dental Research Center, Nihon University School of Dentistry 1-8-13 Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8310, Japan

用アマルガムの電位走査曲線を検討した。

材料および方法

1.電 極

試料電極は,市販の歯科用アマルガム合金4 種(従来型削片状合金1種,高銅型合金3種) を用いて調製した。各電極の本論文で用いる略 号,合金名,組成(製造者表示値)は表1に示 すとおりである。試料電極(電極表面積0.126 cm²)の調製は野元ら²⁾と同様に行った。電極は アマルガム練和後6ヵ月以上経過したものを使 用し,供試直前に耐水研磨紙(#1200,三共)を 用い,注水下で研磨した。対極として白金極 (HP-105,東亜電波工業),参照極として飽和カ ロメル極(HC-205,東亜電波工業)を用いた。 以下,この参照極に対する電位をV(SCE)と 略記する。

2.溶 液

基礎溶液は pH 4 に水酸化ナトリウムで調整 した 50 mM クエン酸塩溶液とし、これに所定 量の水酸化ナトリウム溶液あるいは塩化ナトリ ウム溶液を加えて用いた。試薬はすべて分析試 薬一級である。溶液はとくに脱酸素することな く,室温で実験した。電解用セルは 100 ml 用硬 質ガラス製ビーカーであり、各測定に用いた基 礎溶液の液量は 50 ml である。

3. 電位走查曲線測定装置

電位走査曲線の測定はポテンショスタット (HA-101,北斗電工)に電位走査装置(HB-101, 北斗電工)を付加して行い,X-Y記録計(F-3 DP, 理研電子) で記録した。

4. 測定操作

試料電極を研磨し,水洗の後,基礎溶液に浸 漬する。浸漬後,直ちに電位走査を開始し,走 査開始3分後に電位走査曲線を記録した。次い で電磁式撹拌器(M-21,ヤマト科学)で撹拌し つつ所定の濃度になるように水酸化ナトリウム 溶液あるいは塩化ナトリウム溶液を加え,撹拌 開始から1分後に撹拌を止める。この間,走査 を続行させたままとし,前回の電位走査曲線記 録から3分経過後に添加溶液の電位走査曲線を 記録した。以後,水酸化ナトリウムあるいは塩 化ナトリウム溶液をさらに加え濃度を高くし, 電位走査曲線の測定記録を繰り返した。電位走 査範囲は0.4~-1.5V(SCE)とした。

結 果

1. С Р 極

図1~5に CP 極の成績を示す。pH 4 の基礎 溶液中において-0.3 V (SCE) 付近に酸化電流 の極大を示したが, pH の増加によってその酸 化電流は減少した(図1)。基礎溶液に塩化物イ オンが 50 mM になるように添加した後, pH を 変化させた場合(図2),酸化還元電流は塩化物 イオン無添加の場合(図1)よりも大であった が, -0.3 V (SCE)よりも卑な電位域における pH による変化は微少であった。0.0 V (SCE) よりも貴な電位域の酸化電流は pH 増加によっ て低下し,それとともに-0.2 V (SCE) 付近の

Code	Alloy	Composition (mass%)							Potch No
		Ag	Sn	Cu	Zn	Hg	Pd	others	Datell NO.
СР	G-C's Pre Non Zinc Luna Alloy	70	26	3	—	1	—	_	JJ 13
DJ	Johnson & Johnson Dispersalloy	70	16	13	1	—	—	_	11 GG
DG	G-C's Dialloy	60	25	10	_	_	1	4	JM 4
DS	Shofu Spherical-D	60	22	13	_	_	_	5	117860

表1 Amalgam Alloy



溶液:50 mM クエン酸塩



溶液:50 mM クエン酸塩+50 mM 塩化ナトリウム







溶液:50 mM クエン酸塩(pH 4)+塩化ナトリウ ム



溶液:50 mM 塩化ナトリウム+クエン酸塩(pH 7)

還元電流ピークも小さくなった。pH7の基礎溶 液に塩化物イオンを添加した場合(図3),塩化 物イオン濃度とともに最貴な電位域の酸化電流 が増加し,それとともに0.0~-0.2V(SCE) の還元電流ピークが大になった。pH4の基礎溶 液に塩化物イオンを添加した場合(図4),塩化 物イオン濃度とともに酸化還元電流が大になっ た。

50 mM 塩化ナトリウム溶液に pH 7 のクエ ン酸塩溶液を添加した場合(図 5), クエン酸塩 によって-0.5 V (SCE) 付近の酸化電流が増加 し, -0.3 V (SCE) よりも貴な電位域では逆に 酸化電流が低下した。

2. D J 極

図 6 ~10 に DJ 極の成績を示す。pH 4 の基礎 溶液中において 0.15 V (SCE) 付近に酸化電流 ピークを示し, pH の増加によってピーク電流 は低下し, ピーク電位は卑に移行した (図 6)。 基礎溶液に塩化物イオンが 50 mM になるよう に添加した後, pH を変化させた場合 (図 7), 0.1 V (SCE) 付近の酸化電流は pH 増加ととも に大となり, pH 6 および 7 では -0.1 V (SCE) に新たな還元電流ピークが出現した。pH 7 の基 礎溶液に塩化物イオンを添加した場合 (図 8), 塩化物イオン濃度とともに最貴な電位域の酸化







図7 DJ 極の電位走査曲線 溶液:50 mM クエン酸塩+50 mM 塩化ナトリウム



電流が増加し、それとともに $0.0 \sim -0.2 V$ (SCE)の還元電流ピークが大になった。pH4の 基礎溶液に塩化物イオンを添加した場合(図 9)、塩化物イオン濃度とともに-0.1 V(SCE) よりも貴な電位域の酸化電流が大になり、それ とともに-0.3 V(SCE)付近の還元電流ピーク が大になった。

50 mM 塩化ナトリウム溶液に pH 7 のクエ ン酸塩溶液を添加した場合(図 10), クエン酸塩 によって-0.2 V (SCE) よりも貴な電位域のの 酸化電流が増加し, -0.2 V (SCE) 付近の還元 電流ピークが増加した。

3. D G 極

図 11~15 に DG 極の成績を示す。pH 4 の基 礎溶液中において 0.20 V (SCE) 付近に酸化電 流ピークを示し、pH の増加によってピーク電 流は低下し, ピーク電位は卑に移行した(図 11)。このような変化の大略は DI 極(図6) に 類似であるが、DG 極は DI 極よりも-0.5 V (SCE)付近で大きな酸化電流を示した。基礎溶 液に塩化物イオンが 50 mM になるように添加 した後, pH を変化させた場合 (図 12), 0.1 V (SCE)付近の酸化電流は複雑な変化を示し、pH 増加とともに-0.2 V(SCE)付近の還元電流 ピークが大になった。pH7の基礎溶液に塩化物 イオンを添加した場合(図13),塩化物イオン濃 度とともに-0.1 V (SCE) よりも貴な電位域の 酸化電流が増加し、それとともに 0.0~-0.2 V (SCE)の還元電流ピークが大になった。pH4の 基礎溶液に塩化物イオンを添加した場合(図 14),塩化物イオン濃度とともに-0.7 V(SCE) よりも貴な電位域の酸化電流が大になり、それ とともに還元電流が大になった。

50 mM 塩化ナトリウム溶液に pH 7 のクエ ン酸塩溶液を添加した場合 (図 15), DJ 極と同 様にクエン酸塩によって-0.2 V (SCE) よりも 貴な電位域のの酸化電流が増加し,-0.2 V (SCE) 付近の還元電流ピークが増加した。



溶液:50 mM クエン酸塩



図 12 DG 極の電位走査曲線 溶液:50 mM クエン酸塩+50 mM 塩化ナトリウム





-37 -



溶液:50 mM クエン酸塩 (pH 4)+塩化ナトリウム



4.DS極

図 16~20 に DS 極の成績を示す。pH 4 の基 礎溶液中において 0.30 V (SCE) 付近に酸化電 流ピークを示し, pH の増加によってピーク電 流は低下し, ピーク電位は卑に移行した (図 16)。このような変化の大略は DJ 極 (図 6) に 類似であるが, DS 極は DJ 極よりもピーク電流 値が大であった。基礎溶液に塩化物イオンが 50 mM になるように添加した後, pH を変化させ た場合 (図 17), pH 6, 7 では-0.2 V (SCE), pH 4, 5 では-0.3~-0.4 V (SCE) 付近の還 元電流ピークを示した。pH 7 の基礎溶液に塩化



図 16 DS 極の電位走査曲線





図 17 DS 極の電位走査曲線 溶液:50 mM クエン酸塩+50 mM 塩化ナトリウム









物イオンを添加した場合(図18),塩化物イオン 濃度とともに0.2V(SCE)よりも貴な電位域の 酸化電流が増加し,それとともに0.0~-0.2V (SCE)の還元電流ピークが大になった。pH4の 基礎溶液に塩化物イオンを添加した場合(図 19),塩化物イオン濃度とともに-0.7V(SCE) よりも貴な電位域の酸化電流が大になり,それ とともに還元電流が大になった。

50 mM 塩化ナトリウム溶液に pH 7 のクエ ン酸塩溶液を添加した場合(図 20), クエン酸塩 によって-0.2 V (SCE) よりも貴な電位域のの 酸化電流が増加し, 0.1 および-0.2 V (SCE) 付近の還元電流ピークが増加した。

考 察

1. 従来型アマルガム CP 極

CP 極の電位走査曲線の pH による変化(図 1), pH 7(図3)および pH 4(図4)の溶液 における塩化物イオンによる変化はいずれも 100 mM クエン酸塩溶液に関する前報 N 117) の成績に大略一致していた。

図1の成績で最卑な電位域において還元電流 が零になる電位は前報¹⁾ではpH4よりもpH7 で約200mV卑であり、次の反応から期待され る180mVに

 $Sn+2OH^{-}=Sn(OH)_{2}+2e^{-}$

近いとしたが、本測定では 100 mV しかなかっ た。本測定の50mMでは緩衝能が不足なため、 正常な pH 変化を示さなかったとも考えられる が、この酸化電流の増加が通常の電気化学反応 のように指数関数的な電流増加波形になってい ないことも関係しているように思われる。塩化 物イオンを添加した溶液の pH 変化(図2) で は、pH4とpH7の電位差はさらに小さく100 mV 以下であった。これには上記の理由の他に 錫の塩基性塩化物の生成などが関連しているも のと考えられる。この塩化物イオンを添加した 溶液の pH 変化(図2)は塩化物イオンを含クエ ン酸塩,乳酸塩混合溶液の成績3)に類似し,混 合溶液の場合3)も塩化物イオン含有溶液では 還元電流が零になる電位の pH による変化は小 さかった。

2. 高銅型アマルガム DJ 極 DG 極 DS 極

2.1. 酸化銅(I) 生成電流ピーク

高銅型アマルガム (図6, 11, 16) では-0.1 ~0.3 V (SCE) に明確な酸化電流ピークがあ り, pH 増加によってピーク電位が卑に移行す るとともにピーク電流値が低下した。酸化銅(I) 生成

 $2Cu + H_2O = Cu_2O + 2H^+ + 2e^-$

の平衡電位は pH 7 および pH 4 でそれぞれ– 0.20 および–0.02 V (SCE) であり,電流ピー クの立ち上がり電位に一致している。この様な 成績は既報^{1,3)}に一致していた。

2.2. pH7の溶液における塩化物イオンの影響

高銅型アマルガムの pH7の溶液における塩 化物イオン添加の影響は高銅型アマルガムの種 類によらず類似であった(図8,13,18)。即ち, 塩化物イオン添加によって,酸化銅(I)生成ピー クが大となり,より貴な電位の酸化電流が大に なるとともに $-0.1 \sim -0.3 V$ (SCE)の還元電 流ピークが大になった。これは pH7 では酸化 銅(I) が安定で,クロロ錯体 (CuCl₂-)として の溶出を抑制し,2価銅として水酸化物になる かあるいは溶出することを示している。

2.3. pH4の溶液における塩化物イオンの影響

高銅型アマルガムの pH 4 の溶液における塩 化物イオン添加の影響は高銅型アマルガムの種 類によらず類似であった(図9,14,19)。即ち, 塩化物イオン添加によって,酸化銅(I)は生成 しなくなり,酸化銅(I)を生成する電位域でク ロロ錯体として溶出する。この際,塩化銅(I) 皮膜を形成するので,-0.3~-0.5 V (SCE)に その還元ピークを示した。

2.4. 塩化物イオン含有溶液における pH 変化

塩化物イオン含有溶液でpH を変化させた場 合(図7,12,17),基本的に上記のpH7とpH 4の電位走査曲線を重畳した波形になるが,そ の変化はpH5と6を境界として起こる傾向が みられた。図17のDS 極が典型的であるが,pH 5はpH4の波形に類似であり,pH6はpH7 の波形に類似であった。

DJ 極の pH 4, 5 は図 9 の pH 4 の電位走査 曲線と同じになったが, pH 6, 7 では図 8 の成 績と異なり, 2 つの還元電流ピークになった。 このような変化には塩化物イオン濃度が影響 し、クエン酸塩、乳酸塩混合溶液に100 mMの 塩化物イオンを添加した溶液³⁰ではDG極およ びDS極でもpH6、7で2つの還元電流ピー クが示されている。

結 論

50 mM クエン酸塩溶液中における市販歯科 用アマルガムの電気化学的挙動を電位走査法に より検討した。

従来型アマルガムは pH 増加により錫酸化体 生成電流が低下し,アノード走査において還元 電流が零になる電位が卑へ移行した。塩化物イ オンの添加は酸化還元電流を大にし,pH7では 塩化物イオン濃度とともに塩化銀生成量が増加 したが,pH4では塩化物イオン濃度50 mMに おいて初めて塩化銀生成が認められた。

高銅型アマルガムは塩化物イオン無添加の場 合銅酸化体生成電流ピークのみ著明な電位走査 曲線を示した。塩化物イオンの添加は pH 7 で は塩化銀を生成させたが, pH 4 では銅酸化体の 生成を加速するのみであり,塩化銀の生成は認 められなかった。

文 献

- 鈴木信雄,金子雄治,犬飼誠,相浦洲吉,鈴木 英之,原田秀一郎,野元成晃(1989)クエン酸 塩溶液中における歯科用アマルガムの電気化 学的挙動,日大歯学63,373-378
- 2)野元成晃,守屋和章,木村寿,伊沢三樹,日野 浦光,小野瀬英雄(1979)歯科用アマルガムの 硬化途次における電位走査曲線.日歯保存誌 22,283-290
- 3) 鈴木信雄(1990) 歯科用アマルガムの電気化学 的挙動におよぼすクエン酸塩,乳酸塩混合溶液 の影響.日大歯学 64,57-64